

F2_040401_542000_03

台
图

密级:

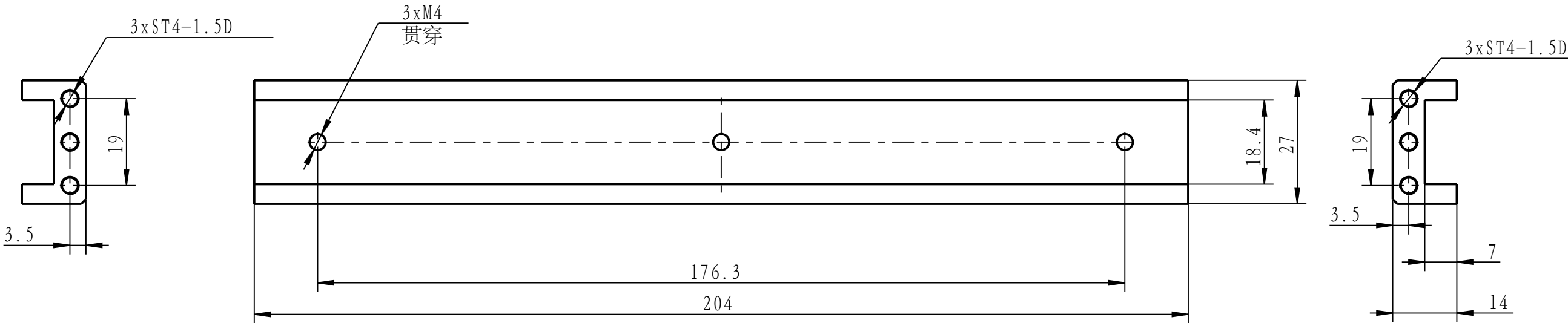
表面处理

激光膜

热处理

其余

Rz3.2



技术要求

- 1, 未注尺寸, 角度公差, 按GB/T1804-m, 未注形位公差按GB/1184-F
2, 锐边倒钝, 去毛刺,

已登件用(借)通
旧底图总号

底图总号

制 图

签 收

日 期

					6061		哈尔滨工业大学		
标记	处数	更改文件号		签字			日期		
设计			会签			重量	0.14		
校对						件数			
			标准化			比例	1:1		
审核			审批			阶段标记	E		
工艺			批准			共 1 张	第 1 张	F2_040401_542000_03	